

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-047294

(43) Date of publication of application: 12.02.2002

(51)Int.Cl.

C07F 9/572 C07C 45/50 C07C 47/02 C07F 9/6503 C07F 9/6506 C07F 9/6524 // C07B 61/00

(21)Application number: 2000-228821

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22)Date of filing:

28.07.2000

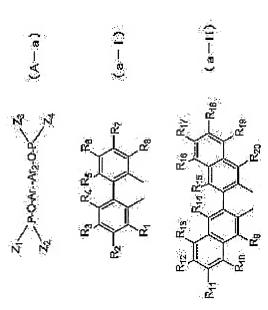
(72)Inventor: CASSAGNE THIERRY

RIRISU JEROME URATA HISAO

# (54) BIDENTATE PHOSPHORUS COMPOUND AND METHOD OF HYDROFORMYLATION USING THE SAME

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a bidentate phosphorus ligand excellent in activity, selectively, thermal stability in a hydroformylation reaction. SOLUTION: This compound is a bidentate phosphorus compound expressed by general formula A-a. [-Ar1-Ar2- is a bisarylene group expressed by general formulas a-I or a-II; Z1 to Z4 are each a five membered heterocycle or its condensate including one or more nitrogen atoms and having nitrogen atom bonding to phosphorus atom; R4 and R5 are each independently an alkyl group, an alkoxy, a cycloalkyl, a cycloalkoxy, a silyl or siloxy group which may contain a substituent or a halogen; R1 to R3 and R6 to R8 are each independently H, an alkyl, an alkoxy, a cycloaklyl, a cycloalkoxy, a dialkyl amino, an aryl, aryloxy, an alkylaryl, an alkylaryloxy, an alkylaryloxy, arylalkyl, an arylalkoxy, cyano, hydroxy, or a halogen; R14 and R15 are each the same as the above R4 and R5; and R9 to R13 and R16 to R20 are each the same as R1 to R3 and R6 to R8)].



(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-47294 (P2002-47294A)

(43)公開日 平成14年2月12日(2002.2.12)

(51) Int.Cl.7		識別割号	FI			デーマコート*(参考)		
C07F	9/572			C07F	9/572		Z	4H006
•							À	4H039
C07C	45/50			C07C	45/50			4H050
	47/02			•	47/02			
C07F	9/6503			C07F	9/6503			
			<b>杂本部</b> 中	<b>士副士</b> 踏了	空頃の数14	OT.	(全 51 百)	易数百い坊く

(21) 出原番号 特題2000-228821(P2000-228821)

 (71) 出顧人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72)発明者 カザーニュ ティエリ

神奈川県横浜市青葉区駒志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 リリス ジェローム

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(74)代理人 100103997

弁理士 長谷川 曉司

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 二座リン化合物及びそれを用いるヒドロホルミル化方法

#### (57)【要約】 (修正有)

【課題】 ヒドロホルミル化反応において活性、選択 性、熱安定性の優れた新規な二座リン配位子を提供す る。

【解決手段】 一般式A-aの二座リン化合物。

$$Z_1$$
 P-O-Ar<sub>1</sub>-Ar<sub>2</sub>-O-P  $Z_3$  (A - a)

 $[-Ar_1-Ar_2-基は一般式a-IXはa-IIのビスアリーレン基、<math>Z_1 \sim Z_4$  はリンと結合する原子が窒素で、1個以上の窒素を含む5 員環の複素環式化合物又はその縮合環式化合物である。

$$R_3 = R_4 R_5 = R_6$$

$$R_4 = R_7 \qquad (a-1)$$

R<sub>6</sub>~R<sub>8</sub>は独立に水素、アルキル、アルコキシ、シクロアルキル、シクロアルコキシ、ジアルキルアミノ、アリール、アリールオキシ、アルキルアリール、アルキルアリールオキシ、アリールアルキル、アリールアルコキシ、シアノ基、水酸基又はハロゲンを表す。)

$$R_{12}$$
 $R_{13}$ 
 $R_{14}$ 
 $R_{15}$ 
 $R_{16}$ 
 $R_{17}$ 
 $R_{18}$ 
 $R_{19}$ 
 $R_{19}$ 
 $R_{19}$ 

 $(R_{14} \land R_{15} \land M \pm C \land L$ 記の $R_4 \land R_5 \land L$ 同じ、 $R_9 \sim R_{13}$ 、 $R_{16} \sim R_{20} \land L R_1 \sim R_3$ 、 $R_6 \sim R_8 \land L$ 同じである。)」

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式 (A-a)で表される二座リン化合物。

#### 【化1】

$$Z_1$$
 P-O-Ar<sub>1</sub>-Ar<sub>2</sub>-O-P  $Z_3$  (A-a)

[式中、 $-Ar_1-Ar_2$ -基は、下記一般式(a-I) 又は(a-II)で表されるビスアリーレン基であり、 $Z_1$  $\sim Z_4$  はリン原子と結合する原子が窒素原子であり、 且つ、少なくとも 1 個の窒素原子を含む 5 員環の複素環式化合物又はその縮合環式化合物である。

#### [12]

$$R_3$$
  $R_4$   $R_5$   $R_6$   $R_7$   $R_8$   $R_9$ 

(式中、 $R_4$  及び $R_6$ は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、シクロアルコキシ基、置換基を有していてもよいシリル基、置換基を有していてもよいシロキシ基及びハロゲン原子からなる群から選ばれるものを表し、 $R_1 \sim R_8$ 、 $R_6 \sim R_8$ は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、シクロアルコキシ基、ジアルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルコキシ基、アリールアルコキシ基、シアノ基、ヒドロキシ基及びハロゲン原子よりなる群から選ばれるものを表す。)

#### [化3]

(式中、 $R_{14}$ 及び $R_{15}$ はそれぞれ独立に一般式(a-I)中の $R_4$ 及び $R_5$ と同義であり、 $R_9$ ~ $R_{18}$ 、 $R_{16}$ ~ $R_{20}$ はそれぞれ独立に一般式(a-I)中の $R_1$ ~ $R_3$ 、 $R_6$ ~ $R_6$ と同義である。)〕

【請求項2】 一般式 (A-a)中の $-Ar_1-Ar_2-$ 基が、一般式 (a-I) で表されるものであり、一般式 (a-I) において、 $R_4$  及び $R_5$ が炭素数  $1\sim3$ のアルキル基、炭素数  $1\sim3$ のアルコキシ基又はハロゲン原子から選ばれる基である請求項 1 に記載の二座リン化合物

【請求項3】 下記一般式 (A-b) で表される二座リン化合物。

#### 【化4】

〔式中、 $-Ar_8-Ar_4$ -基は、下記一般式(b-I) 又は(b-II)で表されるビスアリーレン基であり、 $Z_5$   $\sim Z_6$  はリン原子と結合する原子が窒素原子であり、且つ、少なくとも I 個の窒素原子を含む5員環の複素環式化合物又はその縮合環式化合物である。

#### 【化5】

$$R_{23}$$
  $R_{24}$   $R_{25}$   $R_{26}$   $R_{27}$   $R_{21}$   $R_{28}$ 

(式中、R<sub>22</sub>及びR<sub>26</sub>は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、シクロアルコキシ基、置換基を有していてもよいシリル基、置換基を有していてもよいシロキシ基及びハロゲン原子からなる群から選ばれるものを表し、R<sub>21</sub>、R<sub>22</sub>、R<sub>24</sub>、R<sub>25</sub>、R<sub>27</sub>、R<sub>28</sub>は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、シクロアルコキシ基、ジアルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アルキルアリール基、アリールアルコキシ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、シアノ基、ヒドロキシ基及びハロゲン原子よりなる群から選ばれるものを表す。)

#### 【化6】

(式中、 $R_{34}$ 及び $R_{39}$ はそれぞれ独立に一般式(b-I)中の $R_{23}$ 及び $R_{26}$ と同義であり、 $R_{31}$ ~ $R_{33}$ 、 $R_{35}$  ~ $R_{38}$ 、 $R_{40}$ ~ $R_{42}$ はそれぞれ独立に一般式(b-I)中の  $R_{21}$ 、 $R_{22}$ 、 $R_{24}$ 、 $R_{25}$ 、 $R_{27}$ 、 $R_{28}$ と同義である。)〕

【請求項4】 一般式 (A-b)中の $-Ar_8-Ar_4-$ 基が、一般式 (b-1)で表されるものであり、一般式 (b-1)において、 $R_{23}$ 及び $R_{26}$ が炭素数  $1\sim10$ の アルキル基又は炭素数  $1\sim10$ のアルコキシ基から選ばれる基である請求項3 に記載の二座リン化合物。

【請求項5】 一般式 (A-a) 及び (A-b) 中の $Z_1 \sim Z_8$ が、各々置換基を有していてもよいピロリル基 (pyrrory1)、インドリル基 (indoly1) 又はイミダゾリル基 (imidazoly1) である請求項  $1\sim 4$  のいずれかに記載の二座リン化合物。 【請求項 6】 一般式 (a-I)、 (a-II)、 (b-I) 及び (b-II) において、 $R_1$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ 、 $R_{20}$ 、

 $R_{21}$ 、 $R_{28}$ 、 $R_{31}$ 及び $R_{42}$ が、それぞれ独立に、置換基を有していてもよい炭素数3~20のアルキル基から選ばれるものである請求項1~5のいずれかに記載の二座リン化合物。

【請求項7】 第8族金属化合物の存在下に、オレフィン性化合物を一酸化炭素及び水素と反応させて対応するアルデヒド類を製造するに当り、請求項1~6のいずれかに記載の二座リン化合物を存在させることを特徴とするヒドロホルミル化方法。

【請求項8】 請求項1に記載の二座リン化合物を存在させる請求項7に記載のヒドロホルミル化方法。

【請求項9】 請求項3に記載の二座リン化合物を存在させる請求項7に記載のヒドロホルミル化方法。

【請求項10】 オレフィン性化合物が極性官能基を有しない化合物である請求項7~9のいずれかに記載のとドロホルミル化方法。

【請求項11】 オレフィン性化合物が $\alpha$ -オレフィン である請求項 $7\sim10$ のいずれかに記載のヒドロホルミル化方法。

【請求項12】 オレフィン性化合物がプロピレンである請求項7~11のいずれかに記載のヒドロホルミル化方法。

【請求項13】 第8族金属化合物が、ロジウムである 請求項7~12のいずれかに記載のヒドロホルミル化方 法。

【請求項14】 請求項7~13のいずれかの方法により得られたアルデヒド類をそのまま水素化反応に供するか、又は二量化した後に水素化反応に供給することによりアルコールを製造する方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規な二座リン化合物及びそれを用いるオレフィン性化合物のヒドロホルミル化方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】オレフィン性化合物を触媒の存在下に一酸化炭素及び水素(水性ガス)と反応させて、アルデヒド類またはその水素化物であるアルコール類を製造する方法は、ヒドロホルミル化方法として周知である。ヒドロホルミル化反応の触媒としては通常、有機リン化合物を配位子とする第8族金属の可溶性錯体が用いられている。一般に、触媒の金属成分と共に用いられる配位子は触媒反応に重大な影響を及ぼす。ヒドロホルミル化反応においても配位子により反応の活性及び選択性が大きく変化することが広く知られている。ヒドロホルミル化反応を工業的に有利に実施するためには、反応活性及び選択性の向上が重要な課題であり、そのための配位子の設計が盛んに行なわれている。

【0003】ヒドロホルミル化反応の配位子として利用されるリン化合物の一群としては種々のホスファイト化

合物が知られており、これまでにもトリアルキルホスファイトやトリアリールホスファイトの様な単純なモノホスファイト類の他に、分子中に複数の配位性リン原子を有するボリホスファイト類等の種々のホスファイト化合物が提案されている。例えば、特開昭62-116587号、特開平6-184036号、特開平11-130718号公報には2つのホスファイト基のうちの少なくとも1つが環状構造を有するビスホスファイト化合物が開示されている。

【0004】他方、特開平5-178779号、特開平10-45776号、特開平11-130720号公報には、2つのホスファイト基が共に環化していないビスホスファイト化合物が開示されている。更に、USP5710344には、少なくとも1つのP-C結合又は少なくとも1つのP-N結合を有するリン原子を2つ有する二座配位子が、ペンテン酸エステル等の内部オレフィンのヒドロホルミル化反応に使用できることが開示されている。

【0005】このように、ヒドロホルミル化反応に用いる配位子として種々のリン化合物が提案されているが、これまでに報告されている二座リン化合物を用いたヒドロホルミル化反応では、高い反応速度が得られる場合は目的生成物である直鎖アルデヒドの選択性が不十分であり、逆に極めて高い直鎖選択性が得られる場合は反応速度の点で不十分であった。更に、配位子自体の熱的安定性も不十分であった。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】上記の通り、従来、ヒドロホルミル化反応に用いる配位子として種々のリン化合物が提案されているが、これらを用いたヒドロホルミル化反応では、高い反応速度と高い目的生成物の選択性とが同時には満たされていないことから、商業生産において経済性の低下をもたらすことが危惧され、工業触媒としては用い難いという問題があった。従って、高い反応速度を保ちつつ、優れた目的生成物の選択性を与え、且つ、熱的安定性の高い配位子を開発することが強く望まれていた。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、ヒドロホルミル化反応において、反応活性及び目的生成物の選択性を共に向上・維持するのに有効な配位子の検討を鋭意進める過程で、特定の構造を有する新規な二座リン化合物を見出し、これをヒドロホルミル化反応における触媒の一成分、即ち触媒の金属成分と共に用いられる配位子として用いると、反応が速い速度で進行し、極めて優れた目的生成物の選択性が得られ、且つ、熱的安定性にも優れた性能を示すことを見出して本発明に到達した。即ち本発明の第1の要旨は、下記一般式(A-a)で表される二座リン化合物。

#### [0008]

[
$$\frac{Z_1}{Z_2}$$
 P-O-Ar<sub>1</sub>-Ar<sub>2</sub>-O-P  $\frac{Z_3}{Z_4}$  (A-a)

【0009】[式中、 $-Ar_1-Ar_2$ -基は、下記一般式 (a-I) 又は (a-II)で表されるビスアリーレン基であり、 $Z_1$   $\sim Z_4$  はリン原子と結合する原子が窒素原子であり、且つ、少なくとも1個の窒素原子を含む5員環の複素環式化合物又はその縮合環式化合物である。

[0010]

【化8】

$$R_3$$
  $R_4$   $R_5$   $R_6$   $R_7$   $R_8$ 

【0011】(式中、R4及びR6は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、シクロアルキル基、シクロアルコキシ基、置換基を有していてもよいシリル基、置換基を有していてもよいシロキシ基及びハロゲン原子からなる群から選ばれるものを表し、R1~R2、R6~R8は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、シクロアルコキシ基、ジアルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルコール基、アリールアルコキシ基、シアノ基、ヒドロキシ基及びハロゲン原子よりなる群から選ばれるものを表す。)

[0012]

【化9】

$$R_{12}$$
 $R_{13}$ 
 $R_{14}$ 
 $R_{15}$ 
 $R_{19}$ 
 $R_{10}$ 
 $R_{20}$ 
 $R_{20}$ 
 $R_{20}$ 
 $R_{20}$ 
 $R_{20}$ 

【0013】(式中、 $R_{14}$ 及び $R_{15}$ はそれぞれ独立に一般式(a-I)中の $R_4$ 及び $R_5$ と同義であり、 $R_9$ ~ $R_{12}$ 、 $R_{16}$ ~ $R_{20}$ はそれぞれ独立に一般式(a-I)中の  $R_1$ ~ $R_3$ 、 $R_6$ ~ $R_8$ と同義である。)〕、に存する。

【0014】また、本発明の第2の要旨は、下記一般式(A-b)で表される二座リン化合物。

[0015]

【化10】

【0016】〔式中、 $-Ar_3-Ar_4$ -基は、下記一般式 (b-1) 又は (b-11)で表されるビスアリーレン基であり、 $Z_5$   $\sim Z_8$  はリン原子と結合する原子が窒素

原子であり、且つ、少なくとも1個の窒素原子を含む5 員環の複素環式化合物又はその縮合環式化合物である。

[0017]

【化11】

$$R_{23}$$
  $R_{24}$   $R_{25}$   $R_{25}$   $R_{26}$   $R_{27}$   $R_{27}$   $R_{27}$   $R_{27}$   $R_{27}$ 

【0018】(式中、R<sub>23</sub>及びR<sub>26</sub>は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、シクロアルキル基、シクロアルキシ基、置換基を有していてもよいシリル基、置換基を有していてもよいシロキシ基及びハロゲン原子からなる群から選ばれるものを表し、R<sub>21</sub>、R<sub>22</sub>、R<sub>24</sub>、R<sub>25</sub>、R<sub>27</sub>、R<sub>28</sub>は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、シクロアルキル基、シクロアルコキシ基、ジアルキルアミノ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキシ基、シアノ基、ヒドロキシ基及びハロゲン原子よりなる群から選ばれるものを表す。)

[0019]

【化12】

【0020】(式中、 $R_{34}$ 及び $R_{39}$ はそれぞれ独立に一般式(b-1)中の $R_{23}$ 及び $R_{26}$ と同義であり、 $R_{31}$ ~ $R_{33}$ 、 $R_{35}$ ~ $R_{38}$ 、 $R_{40}$ ~ $R_{42}$ はそれぞれ独立に一般式(b-1)中の  $R_{21}$ 、 $R_{22}$ 、 $R_{24}$ 、 $R_{25}$ 、 $R_{27}$ 、 $R_{28}$ と同義である。)〕、に存する。

【0021】また本発明の第3の要旨は、第8族金属化合物の存在下に、オレフィン性化合物を一酸化炭素及び水素と反応させて対応するアルデヒド類を製造するに当り、請求項1~6のいずれかに記載の二座リン化合物を存在させることを特徴とするヒドロホルミル化方法、に存する。

[0022]

【発明の実施の形態】以下に本発明を更に詳細に説明する。本発明の新規な二座リン化合物(A-a)は、より具体的には、その $-Ar_1-Ar_2-$ 基が下記一般式(a-I)又は(a-II)で表される。

[0023]

【化13】

$$R_2 \xrightarrow{R_3} R_4 R_6 R_6$$

$$R_7 \qquad (a-1)$$

【0024】上記式 (a-I) 又は (a-II) におい て、R<sub>4</sub>、R<sub>5</sub>、R<sub>14</sub>及びR<sub>15</sub>は、例えば、メチル基、エ チル基、nープロピル基、イソプロピル基、セーブチル 基、デシル基等の炭素数1~12の直鎖又は分岐のアル キル基、シクロプロピル基、シクロヘキシル基等の炭素 数3~12のシクロアルキル基、メトキシ基、エトキシ 基、 セーブトキシ基等の炭素数1~12のアルコキシ 基、トリメチルシリル基等のシリル基、トリメチルシロ キシ基等のシロキシ基、塩素原子、フッ素原子、臭素原 子、ヨウ素原子などのハロゲン原子が例示される。これ らの内、メチル基、エチル基等の炭素数1~3の低級ア ルキル基、メトキシ基、エトシキ基等の炭素数1~3の 低級アルコキシ基、塩素原子などのハロゲン原子が好ま しく、メチル基、メトキシ基が特に好ましい。また、シ リル基又はシロキシ基の置換基としては、炭素数1~3 のアルキル基又は炭素数1~3のアルコキシ基が好まし い。また、(a-I)のR<sub>1</sub>~R<sub>3</sub>、R<sub>6</sub>~R<sub>8</sub>、及び式 (a-II)のR<sub>9</sub>~R<sub>13</sub>、R<sub>16</sub>~R<sub>20</sub>は、水素原子の 他、例えばメチル基、エチル基、nープロビル基、iー プロピル基、nーブチル基、sーブチル基、tーブチル 基、nーペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル 基、 もーペンチル基、 もーヘキシル基等の炭素数 1~2 0のアルキル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル 基、アダマンチル基等の炭素数3~20のシクロアルキ ル基、フェニル基、ナフチル基等の炭素数6~20のア リール基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ 基、 tーブトキシ基等の炭素数1~12のアルコキシ 基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等の炭素数2 ~20のジアルキルアミノ基、フェノキシ基、ナフトキ シ基等の炭素数6~20のアリールオキシ基、ベンジル 基等の炭素数7~20のアリールアルキル基、p-トリ ル基、0-トリル基等の炭素数7~20のアルキルアリ ール基の他、シクロペンチルオキシ基等の炭素数3~2 0のシクロアルコキシ基、2,3-キシレノキシ等の炭 素数7~20のアルキルアリールオキシ基、2-(2-ナフチル) エトキシ基等の炭素数7~20のアリールア ルコキシ基、シアノ基、ヒドロキシ基、フルオロ基、ク ロロ基、ブロモ基等のハロゲン原子等が挙げられ、それ ぞれ同一でも異なっていてもよい。式(a-I)及び

(a-II) のビスアリーレン基として好適なものとして は、3,3'ージーセーブチルー5,5',6,6'ー テトラメチルー1,1'ーピフェニルー2,2'ージイ ル基、3, 3, 5, 5, -テトラーセーブチルー6, 6'ージメチルー1,1'ービフェニルー2,2'ージ イル基、3,3',5,5'ーテトラーセーペンチルー 6,6'-ジメチルー1,1'-ビフェニルー2,2' ージイル基、3、3′、5、5′ーテトラー tーヘキシュ ルー6,6'ージメチルー1,1'ーピフェニルー2, 2'ージイル基、3,3'ージーtープチルー5,5' ージメトキシー6,6′ージメチルー1,1′ービフェ ニルー2,2′ージイル基、3,3′ージーセーブチル 1'-ビフェニルー2, 2'-ジイル基、3, 3'-ジ ーセーブチルー5、5′ージエトキシー6、6′ージメ チルー1,1'ービフェニルー2,2'ージイル基、 3.3'ージーセーブチルー5,5'ージーセーブトキ シー6,6'ージメチルー1,1'ービフェニルー2, 2'ージイル基、3,3',5,5'ーテトラ(シクロ オクチル) -6,6'ージメチル-1,1'ービフェニ・ ルー2, 2'ージイル基、3, 3', 5, 5'ーテトラ ーセーブチルー6,6′ージクロロー1,1′ービフェ ニルー2,21ージイル基、等が挙げられる。

【0025】また、本発明の別の新規な二座リン化合物 (A-b)は、より具体的には、その $-Ar_3-Ar_4-$ 基が下記一般式 (b-I) 又は (b-II)で表される。

[0026]

【化14】

$$R_{23}$$
  $R_{24}$   $R_{25}$   $R_{26}$   $R_{27}$   $R_{27}$   $R_{29}$ 

【0027】上記式(b-I)及び(b-II)において、R<sub>23</sub>、R<sub>26</sub>、R<sub>34</sub>及びR<sub>39</sub>は、例えばn-プロピル基、i-プロピル基、s-ブチル基、t-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、t-ペンチル基、なーペンチル基を表し、中でも炭素数3~10のものが好ましく、炭素数4~10のものが特に好ましい。更に芳香環と結合する炭素原子が第3級のものが好ましく、t-ブチル基、t-ペンチル基、t-ペキシル基等が例示される。またこのほか、炭素数1~10、好ましくは1~5のアルコキシ基やシクロペキシル基、シクロオクチル

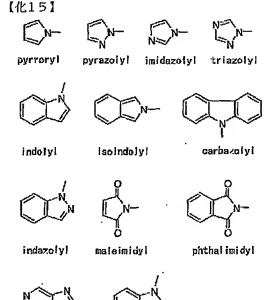
基、アダマンチル基等の炭素数6~14、好ましくは6 ~10のシクロアルキル基、トリメチルシリル基等のシ リル基、トリメチルシロキシ基等のシロキシ基、塩素原 子、フッ素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン 原子が挙げられる。シリル基又はシロキシ基の置換基 は、炭素数1~3のアルキル基又は炭素数1~3のアル コキシ基が好ましい。また、(b-I)の $R_{21}$ 、 $R_{22}$ 、  $R_{24}$ 、 $R_{25}$ 、 $R_{27}$ 、 $R_{28}$ 、及び式(b-II)の $R_{31}$ ~R 33、R<sub>35</sub>~R<sub>38</sub>、R<sub>40</sub>~R<sub>42</sub>は、水素原子の他、例えば メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル 基、nーブチル基、sーブチル基、tーブチル基、nー ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、セーペ ンチル基、 セーヘキシル基等の炭素数1~20のアルキ ル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、アダマン チル基等の炭素数3~20のシクロアルキル基、フェニ ル基、ナフチル基等の炭素数6~20のアリール基、メ トキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、セーブトキ シ基等の炭素数1~12のアルコキシ基、ジメチルアミ ノ基、ジエチルアミノ基等の炭素数2~20のジアルキ ルアミノ基、フェノキシ基、ナフトキシ基等の炭素数6 ~20のアリールオキシ基、ベンジル基等の炭素数7~ 20のアリールアルキル基、p-トリル基、o-トリル 基等の炭素数7~20のアルキルアリール基の他、シク ロペンチルオキシ基等の炭素数3~20のシクロアルコ キシ基、2、3-キシレノキシ等の炭素数7~20のア ルキルアリールオキシ基、2-(2-ナフチル)エトキ シ基等の炭素数7~20のアリールアルコキシ基、シア ノ基、ヒドロキシ基、フルオロ基、クロロ基、ブロモ基 等のハロゲン原子等が挙げられ、それぞれ同一でも異な っていてもよい。

【0028】式 (b-I) 及び (b-II)のビスアリー レン基として好適なものとしては、3,3′ージーも一 ブチルー5,5′ージメチルー1,1′ービフェニルー 2, 2'ージイル基、3, 3', 5, 5'ーテトラー t ーブチルー1,1'ービフェニルー2,2'ージイル 基、3,3',5,5'ーテトラーセーペンチルー1, 1'-ビフェニル-2, 2'-ジイル基、3, 3', 5,5'ーテトラーセーヘキシルー1,1'ービフェニ ルー2,2'ージイル基、3,3'ージーtーブチルー 5,5'ージメトキシー1,1'ーピフェニルー2, 2'ージイル基、3,3'ージーtープチルー5,5' ージエトキシー1,1'ーピフェニルー2,2'ージイ ル基、3,3'ージーセーブチルー5,5'ージーセー プトキシー1,1'ービフェニルー2,2'ージイル 基、3,3',5,5'ーテトラ(シクロオクチル)ー 1,1'ーピフェニルー2,2'ージイル基、等が挙げ られる。

【0029】一般式 (a-I) の $R_1$ 及び $R_8$ 、一般式 (a-II)の $R_9$ 及び $R_{20}$ 、一般式 (b-I) の $R_{21}$ 及び  $R_{28}$ 、一般式 (b-II) の $R_{31}$ 及び $R_{34}$ としては、上述

した置換基の中でも、二座リン化合物の熱安定性が高く、またとドロボルミル化触媒の配位子として用いた場合には、高活性、高選択性を示すという点で、炭素数3~20の直鎖あるいは分岐鎖のアルキル基が列ましく、中でも炭素数4~18のアルキル基が更に好ましく、炭素数4~8の分岐状のアルキル基が特に好ましい。【0030】式(A-a)及び式(A-b)中の $Z_1$ ~ $Z_8$ は、リン原子と結合する原子が窒素原子であり、且つ、少なくとも1個、通常1~4個、好ましくは1~3個の窒素原子を含む5員環の複素環式化合物又はその縮合環式化合物である。 $Z_1$ ~ $Z_8$ としては、中でも、窒素原子を1つ含む5員環の複素環式化合物であるのが好ましく、特にはピロールが好ましい。 $Z_1$ ~ $Z_8$ の具体例としては、下記に示したものが挙げられる。

### [0031]



purinyl benzimidazolyl

【0032】Z<sub>1</sub> ~Z<sub>2</sub>は、更に置換基を有していてもよく、置換基としては、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、sーブチル基、tープチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tーペンチル基等の炭素数1~12、好ましくは1~8、の直鎖あるいは分岐鎖のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~12、好ましくは1~8、のアルコキシ基、フェニル基、ナフチル基等の炭素数6~18、好ましくは6~10のアリール基等が挙げられ、他に、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、トリフルオルメチル基、ヒドロキシル基、アミノ基、アシル基、カルボニルオキシ基、オキシカルボニル基、アシル基、スルホニル基、スルフィニル基、シリル基、テミド基、スルホニル基、スルフィニル基、シリル基、チオニル基等が挙げられる。これらの置換基は一つ

のZに対して1~5個置換していてもよい。 【0033】上記した一般式(A-a)及び(A-b) で表される二座リン化合物の例を次に示す。 [0034] [化16]

[0035]

【化17】

[0036]

【化18】

## (9)開2002-47294(P2002-47294A)

[0037]

【化19】

(10) 12002-47294 (P2002-47294A)

[0038] [他20]

(11) [2002-47294 (P2002-47294A)

[0039]

 (12) \$2002-47294 (P2002-47294A)

[0040]

【化22】

## 

[0041]

[0042]

【化24】

## (15) [2002-47294 (P2002-47294A)

[0043]

【化25】

BNSDOCID: <JP 2002047294A | 1 >

[0044]

## (17) 12002-47294 (P2002-47294A)

[0045]

[0046]

【化28】

(19) \$2002-47294 (P2002-47294A)

[0047]

【化29】

PNSDOCID: < IP 2002047294A | >

[0048]

•

[0049]

[0050]

[0051]

【化33】

BNSDOCID: <JP\_\_\_\_2002047294A\_1\_>

## (23) 引2002-47294 (P2002-47294A)

[0052]

【化34】

DNSDOCID- ZIP 2002047294A 1 >

(24) \$2002-47294 (P2002-47294A)

[0053]

【化35】

(25) \$2002-47294 (P2002-47294A)

[0054]

(26) \$2002-47294 (P2002-47294A)

[0055]

(27) \$2002-47294 (P2002-47294A)

[0056]

[化38]

ENSDOCID:

[0057]

【化39】

(29) \$2002-47294 (P2002-47294A)

[0058]

【化40】

[0059]

【化41】

## (31) 图2002-47294 (P2002-47294A)

[0060]

【化42】

[0061]

【化43】

(33) 月2002-47294 (P2002-47294A)

[0062]

【化44】

[0063]

· (35) 12002-47294 (P2002-47294A)

[0064]

【化46】

[0065]

[0066]

[0067]

BNSDOCID: <JP\_\_\_\_2002047294A\_\_I\_>

[0068]

BNSDOCID: <JP\_\_\_\_2002047284A\_1.>

[0069]

【化52】

[0070]

[0071] [他53]

[0072] [化54]

【化55】

BNSDOCID: <JP\_\_\_\_2002047294A\_]\_>

[0073]

【0074】本発明の一般式(A-a)及び(A-b)で表される二座リン化合物の合成法としては、(1)クロロホスフィンを使用する方法と、(2)ポリ(ジハロゲン化ホスホラス)化合物を経由する方法が挙げられる。以下に例えば、一般式(A-a)の $-Ar_1-Ar_2$ ー基が(a-I)の場合を例にとって合成法を説明する。(1)の合成法としては、例えば特開平10-45775に記載の方法により合成することができ、下記一般式(a-I-1)、中の、R $_1$ ~ $R_8$ は、一般式(a-I-1)、中の、R $_1$ ~ $R_8$ は、一般式(a-I) 中の $R_1$ ~ $R_8$ と同義であり、Mはアルカリ金属塩又はアルカリ土類金属塩を示す。)で表される、それぞれ置換基を有する1, 1 ~ ビフェニルー2, 2 ~ - ジオールのアルカリ金属塩又はアルカリ土類金属塩と、下記一般式(A-a)のA00 (A1) ~ A10 (A2) ~ A2 (A3) A3 (A4) A4 (A4) A5 (A5) A6 (A6) A7 (A7) A8 (A8) A9 (A9) A9

Z4 とそれぞれ同義である。)で表されるリン化合物とを、接触させることにより調製することができる。【0075】【化56】

$$R_3$$
  $R_4$   $R_5$   $R_6$   $R_7$   $R_7$   $R_1$  MO OM  $R_8$ 

$$Z_1$$
  $P-CI$  (B)

$$Z_3$$
  $P-CI$  (C)

【0076】上記一般式(a-1-1)で表されるビス アリーレンジオール塩は下記一般式(a-1-2)(一般式(a-1-2)中の、 $R_1 \sim R_8$ は、それぞれ一般式(a-1)中の $R_1 \sim R_8$ と同義である。)で表される、それぞれ置換基を有する1、1 ービフェニルー2、2 ージオールと、n-BuLi、Na、NaH、KH等のアルカリ金属化合物又は臭化メチルマグネシウム、臭化エチルマグネシウム等のアルカリ土類金属化合物とを、溶媒中、好ましくは窒素等の不活性ガス雰囲気下で反応させることにより合成することができる。

[0077]

【化57】

$$R_3$$
  $R_4$   $R_5$   $R_6$   $R_7$   $R_{1}$   $R_{2}$   $R_{3}$   $R_{4}$   $R_{5}$   $R_{6}$   $R_{7}$   $R_{1}$   $R_{1}$   $R_{2}$   $R_{3}$   $R_{4}$   $R_{5}$   $R_{6}$ 

【0078】上記金属化合物の使用量は、一般式(a-1-2)で表されるビスアリーレンジオール1モルに対 して通常2モルあれば充分であるが、所望によりそれ以 上用いても良い。溶媒としてはテトラヒドロフラン、ジ エチルエーテル等のエーテル類、ヘキサン、トルエン等 の炭化水素類、ピリジン、トリエチルアミン、N,N, N', N'ーテトラメチルエチレンジアミン等の含窒素 化合物及びこれらの混合物が好適に用いられる。反応温 度は、-70℃~溶媒沸点の範囲で適宜選択することが できるが、反応の開始時は低目の例えば-30℃~25 ℃(室温)の間で行い、その後徐々に溶媒の沸点まで上 げるといった方法を採用することもできる。反応操作の 点からは、金属化合物としてn-BuLi、Na又はN aHを用い、溶媒としてはテトラヒドロフランを用い て、反応を行なうことが好ましい。反応時間は通常1分 ~48時間の範囲を選択することができるが、10分か・ ら24時間程度が好ましい。

【0079】一般式(a-I-1)で示される化合物は、次の工程では特に精製することなく反応液をそのまま用いてもかまわないが、予め貧溶媒による洗浄や再結晶操作による単離等の処理を行っても良い。一般式(B)、(C)で示されるリン化合物は、通常、三塩化リン( $PC1_3$ )と $Z_1$  -H、 $Z_2$  -H、 $Z_3$  -H又は $Z_4$  -H(式中、 $Z_1$   $-Z_4$  は一般式(A-a)の $Z_1$   $-Z_4$  と同義である。)で表される複素環式化合物類を塩基の存在下又は不在下、好ましくは窒素等の不活性ガス雰囲気下、溶媒中又は無溶媒で反応を行うことにより合成することができる。 $Z_1$  と $Z_2$  または $Z_3$  と $Z_4$  が同一であるリン化合物は容易に合成できるので好ましい。従って $Z_1$  と $Z_2$  、 $Z_3$ と $Z_4$  の双方がそれぞれに同一である場合がより好ましく、特に、 $Z_1$ 、 $Z_2$ 、 $Z_3$  及び $Z_4$  が同一である場合がさらに好ましい。

【0080】上記塩基としては、ピリジン、トリエチル

アミン、ジエチルアミン等の合窒素塩基、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基が例示される。反応操作の容易さから含窒素塩基が好んで用いられる。塩基の使用量は、PC131モルに対して2モル用いるのが普通である。塩基の量が多すぎたり少なすぎたりすると不必要な $P(Z_1)_2(Z_2)$ 、 $P(Z_1)(Z_2)_2$ 、 $P(Z_1)_3$  等のリン化合物や $C1_2$   $P(Z_1)$  等のジクロロ化合物の副生量が増えるため好ましくない。

【0081】反応温度は任意の温度を選択することができるが、例えば塩基として含窒素塩基を用いる場合では、反応の開始時は低目の温度、例えば0~25℃(室温)で行い、その後、反応温度を徐々に上げるといった方法が好ましい。反応時間は1分から48時間の範囲を選択することができるが、5分から10時間程度の反応時間が好ましい。塩基の存在下で反応を行った際、反応の進行に伴い副生する塩化水素と塩基との塩は、通常固体として反応溶液中に存在するが、これは、好ましくは窒素等の不活性ガス雰囲気下で、沪過する等の方法で反応系から除去することができる。塩基の不在下で反応を行う場合は、窒素ガスやアルゴンガスのような不活性ガスを反応系中にバブルすることにより、副生する塩化水素を反応系から除去する方法等が例示される。

【0082】一般式(B)、(C)で示されるクロロホスフィン類は、上記の不必要なリン化合物類、及びジクロロ化合物との混合物として得られる場合があるが、これらと特に分離することなく次の工程に進んでもかまわない。一般式(B)と(C)のリン化合物をこれらの副生物から分離する方法としては、ヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素溶媒を用いた再結晶化による方法及び蒸留等が挙げられる。

【0083】一般式(A-a-I)の二座リン化合物は、一般式(a-I-1)の化合物と、一般式(B)及び/又は(C)の化合物とを溶媒中又は無溶媒下、25℃以下の温度で1分以上接触させることにより合成することができる。接触は窒素等の不活性ガス雰囲気下で行うのが好ましく、一般式(a-I-1)の化合物と、

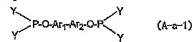
(B) 及び/又は(C)の化合物とを、好ましくは5℃以下、更に好ましくは0℃以下、最も好ましくは-30℃以下の温度で混合し、1分以上、好ましくは3分から60分間その温度を維持した後、徐々に温度を上げて行く方法により目的のビスホスファイト化合物を合成することができる。温度の上昇速度としては、0.1℃/分~20℃/分の間で適宜選択することができるが、0.5℃/分~10℃/分の速度が好ましい。反応溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジオキサン等のエーテル類、ヘキサン、トルエン等の炭化水素類、ビリジン、トリエチルアミン、N,N,N',N'ーテトラメチルエチレンジアミン等の含窒素化合物類、及びこれらの混合物を使用することができる。溶媒の量

は生成する目的物の溶解に必要な最少量を用いるのが望ましいが、それ以上の量を用いても差し支えない。

【0084】次に、(2) ポリ(ジハロゲン化ホスホラス) 化合物を経由する方法について説明する。(2) の合成法としては、例えば特開平2000-53688に記載の方法により合成することができ、下記一般式(A-a1) の多座有機リン化合物と、 $Z_1$  ーH、 $Z_2$  ーH、 $Z_3$  ーH又は $Z_4$  ーH(式中、 $Z_1$  ~ $Z_4$  は一般式(A-a) の $Z_1$  ~ $Z_4$  と同義である。) で表される複、素環式化合物類とを反応させることにより合成する。

[0085]

【化58】



【0086】(式中、 $-Ar_1-Ar_2$ -は、-般式(A-a)で表されたものと同一であり、Yはハロゲン原子を表す。)本発明で使用する $Z_1$ -H、 $Z_2$ -H、 $Z_3$ -H及び $Z_4$ -Hは上述した式(B)又は(C)のリン化合物を合成する過程で使用した複素環式化合物類と同じものを使用できる。

【0087】一般式 (A-a-1) で表わされるポリ (ジハロゲン化ホスホラス) 化合物を原料とし、一般式 (A-a)で表わされる二座リン化合物を製造するにあ たり、塩基の共存は必須ではないが、その共存下では容 易に反応が進行するために有利である。塩基としては、 アルカリ金属としては、リチウム、ナトリウム、カリウ ムが例示され、アルカリ土類金属としてはマグネシウ ム、カルシウムが例示され、炭素数1~22の炭化水素 基を有する二級アミンとしては、ジエチルアミン、ジイ ソプロピルアミンが例示され、炭素数1~22の炭化水 素基を有する三級アミンとしては、トリエチルアミン、 トリプロピルアミン、トリイソプロピルアミン、トリブ チルアミン、トリイソブチルアミン、トリオクチルアミ ン、N, N-ジメチルアニリン、1-メチルピロリジ ン、1ーメチルピペリジン、1ーメチルー2ーピロリド ン、1ーメチルー2ーピペリドン、複素環式芳香族化合 物としてピリジン、2ーピコリン、3ーピコリン、3ー ピコリン、1ーメチルピロールが挙げられ、中でもアル カリ金属もしくは三級アミンが好適である。

【0088】ポリ(ジハロゲン化ホスホラス)化合物、 Z<sub>1</sub>H~Z<sub>4</sub>H、および塩基を反応させる際の各成分の混 合順に制限は無いが、塩基としてアルカリ金属、アルカ リ土類金属を用いる場合は、Z<sub>1</sub>H~Z<sub>4</sub>Hと、塩基を反 応させた後、続いてポリ(ジハロゲン化ホスホラス)化 合物を反応させた方が良好な収率を与えるという点で有 利であり、塩基として二級アミンを用いる場合は、Z<sub>1</sub> H~Z<sub>4</sub>Hと、ポリ(ジハロゲン化ホスホラス)化合物 を混合した後に塩基を反応させるか、もしくはZ<sub>1</sub>H~ Z<sub>4</sub>Hと塩基を混合させた後、続いてポリ(ジハロゲン 化ホスホラス)化合物を反応させた方が良好な収率を与えるという点で有利である。三級アミン、もしくは活性水素原子を有しない複素環式芳香族化合物を用いる場合、混合順序に制限は無いが、予めZ<sub>1</sub> H~Z<sub>4</sub> Hと、もしくは、Z<sub>1</sub>H~Z<sub>4</sub> Hと塩基を混合させ続いてポリ(ジハロゲン化ホスホラス)化合物を反応させた方が有利である。

【0089】本発明の反応を行う際に用いる塩基の使用 量は特に制限されるものではなく、通常はポリ(ジハロ ゲン化ホスホラス) 化合物のリン原子に結合したハロゲ ン原子の数に対して0.01モル倍から10000 モル倍の範囲 で選ばれ、好ましくは0.1 モル倍から100 モル倍、特に 好ましくは1モル倍から10モル倍の範囲で選ばれる。 【0090】本発明の反応を行う際に、反応溶媒の使用 は必須ではないが、必要ならば反応に不活性な溶媒を存 在させることが出来る。好ましい溶媒の具体例は、ヘキ サン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素、トル エン、キシレン、ドデシルベンゼン等の芳香族炭化水 素、アセトン、ジエチルケトン、メチルエチルケトン等 のケトン類、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、テ トラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、酢酸エ チル等のエステル類、トリエチルアミン、トリプロピル アミン、1ーメチルー2ーピロリドン、1ーメチルー2 ーピペリドン等の三級アミン類、ピリジン、2ーピコリ ン等の複素環式芳香族化合物、ポリ(ジハロゲン化ホス ホラス) 化合物の製造時に副生する混合物が挙げられ、 ポリ (ジハロゲン化ホスホラス) 化合物自体、Z1H~ Z<sub>4</sub>Hを溶媒として用いることもできる。

【0091】本発明の反応を行う際に用いる $Z_1$ H $\sim Z_4$ Hの使用量は特に制限されるものではなく、通常はポリ(ジハロゲン化ホスホラス)化合物のリン原子に結合したハロゲン原子の数に対して0.01モル倍から10000 モル倍の範囲で選ばれ、好ましくは0.1 モル倍から100 モル倍、特に好ましくは1 モル倍から1 0 モル倍の範囲で選ばれる。

【0092】本発明の反応を行う際の反応温度は-78 ℃ から80℃の範囲で選ばれ、好ましくは-50 ℃から30℃、特に好ましくは-30 ℃から10℃の範囲、最も好ましくは、-15から5℃の範囲で選ばれる。

【0093】本発明に使用する溶媒および全ての薬品類に混入する可能性のある、反応に活性な不純物の除去は必須ではないが、除去を行ったほうが収率が向上するため経済的に有利であり好ましい。

【0094】本発明が適用出来る二座リン化合物の合成法に制限は無いが、一般式 (A-a-1) のポリ (ジハロゲン化ホスホラス) 化合物に対し、 $Z_1H\sim Z_4$  Hは同時に反応させても、段階的に反応させてもよいが、-P  $(Z_1)$   $(Z_2)$  基上の $Z_1$ と $Z_2$  が事なる二座リン化合物をより有利に合成する目的には段階的合成法が適している。すなわち、一般式 (A-a-1) で表わされる

ボリ(ジハロゲン化ホスホラス)化合物と、複素環式化合物類を反応させる時に、各々のジハロゲン化ホスホラス基の一つのハロゲン原子が優先的に置換される。そのため、リン原子数と同じ数の $Z_1$ Hを反応させることにより、各々 $-P(Z_1)(Z_2)$ 基上の $Z_1$ と $Z_2$ 、が異なる二座リン化合物を合成する事が可能である。この方法により合成される二座リン化合物は、配位子として触媒反応に使用されるとともに、各々のリン原子がキラリティーを持つため、配位子として不斉触媒反応への使用や、不斉化合物の光学分割への用途に適する。また、高分子材料への添加剤としての用途にも適する。

【0095】一般式(A-a-1)で表わされるポリ(ジハロゲン化ホスホラス)化合物は、種々の反応により合成する事が可能である。例えば、DE19513541では、ビスフェノール類等のように、対応するポリヒドロキシ化合物と三塩化リンとの反応により得られることが記載されている。また、A. A. Kutyrev らは、1、4ーベンゾキノンと三塩化リンとの反応により、対応するジクロロホスファイトが得られることを報告している(Zh.

Obshch. Khim. 62(8)、1768 -1771(1992))。更に、特開2000-53688に記載されているように、ポリ(ビス(ジヒドロカルビルアミノ)ホスホラス)化合物とHYで表わされるハロゲン化水素を反応させる方法を採用する事により、ポリ(ジハロゲン化ホスホラス)化合物を良好な収率で、かつ、同時に副反応である分子内環化反応を抑制することが出来る。

【0096】上述した合成法に従って、一般式 (Aa) の-Ar<sub>1</sub>-Ar<sub>2</sub>-基が、(a-II) の二座リン化 合物の場合や、一般式 (A-b) の-Ar<sub>3</sub>-Ar<sub>4</sub>-基 が、(b-I)又は(b-II)の二座リン化合物の場合 についても、同様に合成することができる。上述した (1)と(2)の方法の中でも、(1)の合成法の方が 好ましい。一般式 (A-a) 及び (A-b)の二座リン 化合物の精製方法としては、カラム展開〈クロマトグラ フィー)による方法、懸洗による方法、及び再結晶化に よる方法等が挙げられる。カラム展開による方法として は充填剤としてはシリカゲル、酸化アルミナ等を用いる 方法が挙げられる。またカラムの展開溶液としてはテト ラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、ヘキサ ン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素類、トルエン、キシレ ン等の芳香族炭化水素類、酢酸エチル、酢酸メチル等の エステル類、クロロホルム、ジクロロメタン等のハロゲ ン化炭化水素類が挙げられ、これらの溶液は目的物の精 製に適するよう、単一溶媒、或いは2種類以上の溶媒を 混合して用いられる。

【0097】また、懸洗による精製方法としては、二座 リン合成反応の終了後、沪別、或いは水等の極性溶媒に より副生した塩、例えば金属塩化物 (MC1) 又は含窒 素化合物の塩酸塩を反応溶液から除去した後、溶液を蒸発乾涸し、残留物をアセトニトリル、ヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素類、アセトン、ジエチルケトン等のケトン類、メタノール、エタノール等のアルコール類等の溶媒中で撹拌することにより、目的物をこれらの溶媒に溶解させることなく、不要物を溶媒に溶解させる方法により目的物を精製することができる。

【0098】再結晶化による精製方法としては、二座リ ン化合物の合成反応の終了後、沪別、或いは水等の極性 溶媒により副生した塩、例えば金属塩化物又は含窒素化 合物の塩酸塩を反応溶液から除去した後、溶液を蒸発乾 涸し、残留物を溶解し得る最少量の溶媒に溶解させた 後、冷却することによる方法、及び、残留物を溶解し得 る溶媒に溶解した後、目的物の二座リン化合物の不溶も しくは難溶の溶媒を添加し、所望により冷却することに よる方法等により固体を析出させ、固体を沪過等の方法 により分離し、さらに固体が不溶の溶媒で洗浄する方法 等が挙げられる。二座リン化合物が可溶な溶媒として は、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素 類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類が 挙げられ、難溶な溶媒としては、アセトニトリルの他、 ヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素類、アセトン、 ジエチルケトン等のケトン類、メタノール、エタノール 等のアルコール類が例示される。

【0099】本発明においては、前述した新規な二座リ ン化合物を用いてヒドロホルミル化反応を行うことで、 高い反応速度と優れた目的生成物の選択性を同時に満た すことが可能となる。本発明のヒドロホルミル化方法に おいて、反応原料として使用されるオレフィン性化合物 としては、分子内にオレフィン性二重結合を少なくとも 1つ有する有機化合物であれば特に制限はない。具体的 には、エチレン、プロピレン、ブテン、ブタジエン、ペ ンテン、ヘキセン、ヘキサジエン、オクテン、オクタジ エン、デセン、ヘキサデセン、オクタデセン、イコセ ン、ドコセン、スチレン、αーメチルスチレン、シクロ ヘキセン、および、プロピレン~ブテン混合物、1-ブ テン~2-ブテン~イソブチレン混合物、1-ブテン~ 2ーブテン〜イソブチレン〜ブタジエン混合物等の低級 オレフィン混合物、プロピレン、nーブテン、イソブチ レン等の低級オレフィンの二量体~四量体のようなオレ フィンオリゴマー異性体混合物等のオレフィン類、アク リロニトリル、アリルアルコール、1-ヒドロキシー 2, 7-オクタジエン、3-ヒドロキシー1, 7-オク タジエン、オレイルアルコール、1ーメトキシー2,7 ーオクタジエン、アクリル酸メチル、メタアクリル酸メ チル、オレイン酸メチル等の極性基置換オレフィン類等 が挙げられる。本発明においては、上述した中でも、極 性官能基を有しないオレフィン性化合物が好ましく、α ーオレフィンがより好ましく、プロピレンが最も好まし 11

【0100】ヒドロホルミル化反応の触媒又はその前駆 体として用いる第8族金属化合物としては、第8族金属 の水素化物、ハロゲン化物、有機酸塩、無機酸塩、酸化 物、カルボニル化合物、アミン化合物、オレフィン配位 化合物、ホスフィン配位化合物またはホスファイト配位 化合物等が使用可能で、例えば、三塩化ルテニウム、テ トラアシミンヒドロキソクロロルテニウムクロリド、ジ クロロトリス (トリフェニルホスフィン) ルテニウム等 のルテニウム化合物、酢酸パラジウム、塩化パラジウム 等のパラジウム化合物、三塩化オスミウム等のオスミウ ム化合物、三塩化イリジウム、イリジウムカルボニル等 のイリジウム化合物、白金酸、ヘキサクロロ白金酸ナト リウム、第二白金酸カリウム等の白金化合物、ジコバル トオクタカルボニル、ステアリン酸コバルト等のコバル ト化合物、三塩化ロジウム、硝酸ロジウム、酢酸ロジウ  $\Delta$ , Rh (acac) (CO)<sub>2</sub>, (Rh (OAc)  $(COD)_{2}$ ,  $Rh_{4}$   $(CO)_{12}$ ,  $Rh_{6}$  (C $O)_{16}$ ,  $HRh(CO)(PPh_3)_3$ ,  $(Rh(OA)_{16}$ c)  $(CO)_2$   $]_2$   $(Rh(\mu-S(t-Bu))$  $(CO_2)_2$ ,  $(RhCl(COD))_2$  (acacid アセチルアセトナト基を、OAc はアセチル基を、CO Dは1, 5ーシクロオクタジエンを、Phはフェニル基 を、 t-Buは第3ブチル基をそれぞれ表す)等のロジ ウム化合物が挙げられるが、必ずしもこれらに限定され るものではない。本発明においては、中でもコバルト、 ロジウム、ルテニウムが好ましく、ロジウムが最も好ま しい。

【0101】本発明方法において、二座リン化合物は予め上記の第8族金属化合物と錯体を形成させて用いることができる。二座リン化合物を含む第8族金属錯体は、第8族金属の化合物と該二座リン化合物とから、公知の錯体形成方法により容易に調製することができる。また、場合によっては、第8族金属化合物と前記二座リン化合物とをヒドロホルミル化反応帯域に供給してそこで錯体を形成させて用いることもできる。第8族金属化合物の使用量は、特に限定されるものではなく、触媒活性及び経済性等から考慮される限界があるが、本発明においては、通常ヒドロホルミル化反応帯域における濃度が金属原子換算でオレフィン性化合物または反応溶媒1リットルに対し0.05mg~5g、好ましくは0.5mg~1gの範囲から選ばれる。

【0102】本発明において、二座リン化合物の使用量は特に制限されるものではなく、触媒の活性、選択性に対して望ましい結果が得られるように適宜設定される。 通常は第8金属1モル当たり約0.001~500モル、好ましくは0.1~100モルの範囲から選ばれる。 ヒドロホルミル化反応を行なうにあたって、反応溶媒の使用は必須ではないが、必要ならばヒドロホルミル化反応に不活性な溶媒を存在させることができる。 好ましい溶媒の具体例としては、トルエン、キシレン、トデ

シルベンゼン等の芳香族炭化水素、アセトン、ジエチルケトン、メチルエチルケトン等のケトン類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、酢酸エチル、ジーnーオクチルフタレート等のエステル類、アルデヒド縮合体等のヒドロホルミル化反応時に副生する高沸点成分又は、反応原料であるオレフィン性化合物等が挙げられる。

【0103】本発明のヒドロホルミル化方法を行なうための反応条件は、従来通常に用いられたものと同様であり、反応温度は、通常、15~200℃、好ましくは50~150℃の範囲から選ばれ、CO分圧及びH2分圧は通常、0.001~200気圧、好ましくは0.1~100気圧、特に好ましくは1~50気圧の範囲から選ばれる。水素と一酸化炭素とのモル比(H2/CO)は通常、10/1~1/10、好ましくは1/1~1/6の範囲から選択される。ヒドロホルミル化反応の方式としては、撹拌型反応槽または気泡塔型反応槽中で連続方式または回分方式のいずれでも行なうことができる。

【0104】本発明の、一般式(A-a)又は(Ab)で示される新規な二座リン化合物を用いたヒドロホ ルミル化反応系では、生成したアルデヒドを蒸留等の方 法により分離した後に、この第8族金属及び二座リン化 合物を含む回収液を用いて、再びオレフィン性化合物の ヒドロホルミル化反応を行うことができる。更に、連続 的にオレフィン性化合物をアルデヒドに転化する際に、 生成するアルデヒドの一部または全部を分離した残りの 反応液を、触媒液として連続的にヒドロホルミル化反応 槽に循環させることもできる。本発明の方法により得ら れたアルデヒド類は、公知の方法、例えばUSP555 0302やUSP5667644に従って、そのまま水 添反応に供するか、又は二量化した後に水添反応に供す ることにより、ノルマルブタノール、2ーエチルヘキサ ノール、ノニルアルコール等の可塑剤用に好適なアルコ ールを製造することが可能となる。

## [0105]

【実施例】次に本発明の具体的態様を、実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の実施例によって限定されるものではない。 【0106】実施例-1(テトラピロリルビスホスファイト(配位子1)の合成)

4.5mmol)のTHF溶液(40ml)をn-BuLi(29mmol)のヘキサン溶液とを0℃で混合し、その後1.2時間加熱還流し、ビフェノールのLi塩を得た。ジピロリルクロロホスフィンのトルエン溶液に、ビフェノールのLi塩を0℃にて滴下した。反応後、塩を沪別し、沪液を濃縮した。残った残さをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開液:トルエン:ヘキサン=1:5)により単離精製した結果、下記に示す構造の配位子1を2.13g(19%)得た。

mp 215.6-216.3°C  $^{31}P-NMR$  (CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$ 99.78  $^{1}H-NMR$  (CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$ 7.37 (s.2H), 6.81 (m,4H),6.68 (m,4H),6.2 0 (m,4H),6.15 (m,4H),1.94 (s,6H),1.29 (s,18H),1.06 (s,18H)

[0107]

【化59】

配位子1

【0108】上記配位子1の構造は、リン31-核磁気 共鳴分光光度法、プロトン核磁気共鳴分光光度法(装置 はバリアン社製ユニティー300型)又は元素分析法を 用いて確認した。

【0109】反応例-1(配位子2を用いたヒドロホルミル化反応)

乾燥させた窒素雰囲気下、ガラス容器内に19.7mgの(Rh(cod)(OAc))2、下記に示した二座リン配位子2 214.4mg、55mlの脱気脱水したトルエン、及び5mlの脱気脱水したヘプタン(反応後のガスクロマトグラフィー分析の内部標準)を加え、均一な溶液を調製した。続いて、よく乾燥した内容積200mlのステンレス鋼製上下攪拌型オートクレーブを乾燥窒素にて3回置換し、上記溶液を窒素雰囲気下、窒素圧によりオートクレーブ内に圧入し密閉した。更に4.5gのプロピレンをオートクレーブ内に圧入して密閉した後、オートレーブを70℃まで昇温した。この時、内圧は4kg/cm²であった。その後、合成ガス

( $H_2: CO=1:1$ )をオートレーブ内に導入してプロピレンのヒドロホルミル化反応を開始したが、合成ガスは蓄圧器より二次圧力調整器を介して導入し、反応中常にオートクレープ内の全圧が $9kg/cm^2$ になるようにした。5.0時間後、蓄圧器の圧力低下がほぼ無くなり、反応を終了

した。反応終了後、オートクレーブを室温まで冷却し、オートクレーブ内の気相及び液相を捕集し、それぞれをガスクロマトグラフィーを用いて成分分析した。その結果、プロピレンの転化率は93.7%、C4-アルデヒド収率は91.9%であり、C4-アルデヒドにおける目的物のn-ブチルアルデヒドと副生成物のi-ブチルアルデヒドの此(n/i 比)は、25.5であった。また、蓄圧器の圧力低下率から求めた反応速度定数は、0.53h<sup>-1</sup>であった。また、反応液の<sup>31</sup>P-NMR測定を行った結果、100.8ppmに避離の配位子に基づくシグナルが、また、138~142ppmにRh-P錯体に基づくシグナルが観測されたが、それ以外、配位子の分解に基づくシグナルは観測されなかった。

【0110】 【化60】

配位子2

【0111】反応例-2(配位子1を用いたヒドロホルミル化反応)

反応例 -1 において用いた214.4mgの配位子2の代わりに222.6mgの上記実施例 -1 で合成した二座リン配位子1を用い、それ以外は同様の方法でプロピレンのヒドロホルミル化反応を実施した。反応時間は2.0時間であった。同様の分析を行った結果、プロピレンの転化率は96.6%、 $C_4$ -アルデヒド収率は94.8%であり、 $C_4$ -アルデヒドにおけるn/i比は、100.9であった。また、反応速度定数は、 $2.16h^{-1}$ であった。また、反応液の $3^{1}$ P-NM配測定を行った結果、99.5Ppmに遊離の配位子に基づくシグナルが、また、137.7Ppm  $\{d, {}^{2}J_{Rh-P}=209.8$ Hz $\}$  にRh-P錯体に基づくシグナルが観測されたが、それ以外、配位子の分解に基づくシグナルは観測されなかった。

## [0112]

【発明の効果】本発明の二座リン化合物は、水素化、ヒドロホルミル化、ヒドロシアノ化、ヒドロカルボキシル化、ヒドロアミド化、ヒドロエステル化、アルドール縮合等の種々の有機反応において、均一系金属触媒の構成要素として使用することの可能な新規化合物である。本発明方法において、特定の構造を有する二座リン化合物をヒドロホルミル化反応において触媒成分として用いることにより、高い反応活性のみならず極めて高いアルデヒド異性体選択性が得られるので、ヒドロホルミル化反応を工業的に有利に実施することができる。

## (51) \$2002-47294 (P2002-47294A)

フロントページの続き

(51) Int.CI.7 識別記号

FI

(参考)

CO7F 9/6506

CO7F 9/6506

9/6524

9/6524

// CO7B 61/00

CO7B 61/00

300

\_\_

Fターム(参考) 411006 AA02 AC45 BA24 BA48 BE20

BE40

4H039 CA62 CL45

4H050 AB40

(72)発明者 浦田 尚男

茨城県稲敷郡阿見町中央八丁目3番1号

300

三菱化学株式会社筑波研究所内